G DIODE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

Patent Number:

JP2002314140

Publication date:

2002-10-25

Inventor(s):

OUCHI KATSUYA; TSUMURA MANABU; SAKAMOTO HARUMI; KURAMOTO MASAFUMI; MIKI

MICHIHIDE

Applicant(s):

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD;; NICHIA CHEM IND LTD

Requested Patent: JP2002314140

Application

Number:

JP20020031975 20020208

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L33/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light emitting diode having a high durability and a manufacturing method

SOLUTION: A light emitting element is covered with a setting compound containing an organic compound having at least two carbon-carbon double bonds reactive with SiH group in one molecule, a compound having at least two SiH groups in one molecule and a hydrosilylated catalyst as necessary components.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-314140 (P2002-314140A)

(43)公開日 平成14年10月25日(2002.10.25)

(51) Int.Cl.7

說別記号

FI.

テーマコード(参考)

HO1L 33/00

H01L 33/00

N 5F041

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 17 頁)

特願2002-31975(P2002-31975)

(22)出顧日

平成14年2月8日(2002.2.8)

(31) 優先権主張番号 特願2001-33503 (P2001-33503)

(32) 優先日

平成13年2月9日(2001.2.9)

(33)優先權主張国

日本(JP)

(71)出願人 000000941

鐘淵化学工業株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

(74)上記1名の代理人 100086586

弁理士 安富 康男 (外1名)

(71)出顧人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(74)上記1名の代理人 100086586

弁理士 安富 康男

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 発光ダイオード及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 高い耐久性を有する発光ダイオードおよびそ の製造方法を提供すること。

【解決手段】 SiH基と反応性を有する炭素-炭素二 重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機化合物 と、1分子中に少なくとも2個のSiH基を含有する化 合物と、ヒドロシリル化触媒とを必須成分として含有す る硬化性組成物を用いて発光素子を被覆すること。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) Si H基と反応性を有する炭素 - 炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSi H基を含有する化合物、(C) ヒドロシリル化触媒、を必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光素子が被覆された発光ダイオード。

【請求項2】 発光素子の主発光ビーク液長が550nm以下である、請求項1に記載の発光ダイオード。

【請求項3】 前記発光素子は、珪素を含有する無機化合物層を表面に有し、前記無機化合物層に接して前記硬化性組成物が設けられていることを特徴とする請求項1 または2に記載の発光ダイオード。

【請求項4】 前記無機化合物層は、前記発光素子から発光される光の少なくとも一部を吸収して他の波長を有する光を発光することが可能な蛍光物質を含有することを特徴とする請求項3に記載の発光ダイオード。

【請求項5】 (A) Si H基と反応性を有する炭素 - 炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSi H基を 20含有する化合物、(C) ヒドロシリル化触媒、を必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光素子を被覆することによる、請求項1~4のいずれか1項に記載の発光ダイオードを製造する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は高い耐久性を有する 発光ダイオードおよびその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、発光ダイオードの発光素子の被覆材(封止材あるいはモールド材)としては酸無水物系硬化剤を用いる透明エポキシ樹脂等が広く用いられてきた。これらの従来の被覆材は発光素子、リードフレーム等との接着性等が良好であるが、特に低波長の光に対する光線透過性が低いために耐光耐久性が低いという欠点を有していた。この点を改善するためにエポキシ樹脂系での改良が提案されている(特開2000-196151号公報、特開平11-274571号公報)。一方、耐光耐久性が高い被覆材として、シリコーン樹脂が使用されているが、一般に軟質であり表面タック性を有しているため、実装する際に発光面に異物が付着したり実装用器具により発光面が損傷を受けるという問題があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、高い耐久性を有し、かつ、実装する際に発光面に異物が付着したり実装用器具により発光面が損傷を受けるという問題が生じない発光ダイオードおよびその製造方法を提供することである。

[0004]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するために本発明者らは鋭意研究の結果、SiH基と反応性を有する炭素 – 炭素二重結合を含有する有機化合物と、SiH基を含有する化合物と、ヒドロシリル化触媒とを必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光素子を被覆することにより、上記課題が解決できることを見出し本発明に至った。

【0005】すなわち、本発明は、(A) Si H基と反 応性を有する炭素-炭素二重結合を1分子中に少なくと も2個含有する有機化合物、(B)1分子中に少なくと も2個のSiH基を含有する化合物、(C)ヒドロシリ ル化触媒、を必須成分として含有する硬化性組成物を用 いて発光素子が被覆された発光ダイオード(請求項1) であり、発光素子の主発光ピーク波長が550nm以下 である、請求項1に記載の発光ダイオード(請求項2) であり、前記発光素子は、珪素を含有する無機化合物層 を表面に有し、前記無機化合物層に接して前記硬化性組 成物が設けられている、請求項1または2に記載の発光 ダイオード (請求項3)であり、前記無機化合物層は、 前記発光素子から発光される光の少なくとも一部を吸収 して他の波長を有する光を発光することが可能な蛍光物 質を含有する、請求項3に記載の発光ダイオード(請求 項4)であり、(A)SiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機 化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSiH基を 含有する化合物、(C)ヒドロシリル化触媒、を必須成 分として含有する硬化性組成物を用いて発光素子を被覆 することによる、請求項1~4のいずれか1項に記載の 30 発光ダイオードを製造する方法(請求項5)である。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 【0007】まず、本発明における(A)成分について 説明する。

【0008】(A)成分はSiH基と反応性を有する炭素ー炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機化合物であれば特に限定されない。有機化合物としてはボリシロキサンー有機ブロックコボリマーやボリシロキサンー有機グラフトコボリマーのようなシロキサン単位(Si-O-Si)を含むものではなく、構成元素としてC、H、N、O、S、ハロゲンのみを含むものであることが好ましい。シロキサン単位を含むものの場合は、ガス透過性やはじきの問題がある。

【0009】SiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合の結合位置は特に限定されず、分子内のどこに存在してもよい。

【0010】(A)成分の有機化合物は、有機重合体系の化合物と有機単量体系化合物に分類できる。

【0011】有機重合体系化合物としては例えば、ポリ 50 エーテル系、ポリエステル系、ポリアリレート系、ポリ

カーボネート系、飽和炭化水素系、不飽和炭化水素系、 ポリアクリル酸エステル系、ポリアミド系、フェノール ーホルムアルデヒド系(フェノール樹脂系)、ポリイミ ド系の化合物を用いることができる。

【0012】また有機単量体系化合物としては例えば、フェノール系、ビスフェノール系、ベンゼン、ナフタレン等の芳香族炭化水素系:直鎖系、脂環系等の脂肪族炭化水素系:複素環系の化合物およびこれらの混合物等が挙げられる。

【0013】(A)成分のSiH基と反応性を有する炭 10素-炭素二重結合としては特に限定されないが、下記一般式(I)

[0014] [化1]

【0015】(式中R'は水素原子あるいはメチル基を表す。)で示される基が反応性の点から好適である。また、原料の入手の容易さからは、

[0016] [化2]

【0017】で示される基が特に好ましい。 【0018】(A)成分のSiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合としては、下記一般式(II) [0019] [化3]

【0020】(式中R'は水素原子あるいはメチル基を表す。)で示される脂環式の基が、硬化物の耐熱性が高いという点から好適である。また、原料の入手の容易さからは、

[0021] [化4]

【0022】で示される脂環式の基が特に好ましい。
20 【0023】SiH基と反応性を有する炭素 - 炭素二重 結合は(A)成分の骨格部分に直接結合していてもよく、2価以上の置換基を介して共有結合していても良い。2価以上の置換基としては炭素数0~10の置換基であれば特に限定されないが、構成元素としてC、H、N、O、S、ハロゲンのみを含むものが好ましい。これらの置換基の例としては、

[0024] [化5]

(4)

(nは1~10の数を表す。),

(nは0~4の数を表す。)

[0025]

CH2=CH-CH2 (0-CH2 CH2)

(nは5≧n≧2を満足する数を表す。),

(nは0~4の数を表す。)

【0026】が挙げられる。また、これらの2価以上の 50 置換基の2つ以上が共有結合によりつながって1つの2

(2)

価以上の置換基を構成していてもよい。

【0027】以上のような骨格部分に共有結合する基の例としては、ビニル基、アリル基、メタリル基、アクリル基、メタクリル基、2-ヒドロキシ-3-(アリルオキシ)プロビル基、2-アリルフェニル基、3-アリルフェニル基、4-アリルフェニル基、2-(アリルオキシ)フェニル基、3-(アリルオキシ)フェニル基、3-(アリルオキシ)フェニル基、4*

* - (アリルオキシ)フェニル基、2 - (アリルオキシ) エチル基、2、2 - ビス(アリルオキシメチル)ブチル 基、3 - アリルオキシー2、2 - ビス(アリルオキシメ チル)プロビル基、

[0028] [化7]

1167

CH2=CH-CH2 (0-CH2-CH2)

(nは5≧n≧2を満足する数を表す。)

(nは0~4の数を表す。)

【0029】が挙げられる。

【0030】(A)成分の具体的な例としては、ジアリ 30ルフタレート、トリアリルトリメリテート、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル、1, 1, 2, 2 - テトラアリロキシエタン、ジアリリデンペンタエリスリット、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、1, 2, 4 - トリビニルシクロヘキサン、ジビニルベンゼン類(純度

50~100%のもの、好ましくは純度80~100%のもの)、シビニルビフェニル、1、3-ジイソプロペニルベンゼン、1、4-ジイソプロペニルベンゼン、およびそれらのオリゴマー、1、2-ポリブタジエン(1、2比率10~100%のもの、好ましくは1、2比率50~100%のもの)、ノボラックフェノールのアリルエーテル、アリル化ポリフェニレンオキサイド、【0031】 【化8】

から選ばれる2価の基を表す。

$$(n = 1)$$

[0032]

【化9】

【0033】の他、従来公知のエポキシ樹脂のグリシジ ル基をアリル基に置き換えたもの等が挙げられる。

【0034】(A)成分としては、上記のように骨格部 分と炭素 - 炭素二重結合とに分けて表現しがたい、低分 子量化合物も用いることができる。これらの低分子量化 合物の具体例としては、ブタジエン、イソプレン、オク タジエン、デカジエン等の脂肪族鎖状ポリエン化合物 系、シクロペンタジエン、シクロヘキサジエン、シクロ オクタジエン、ジシクロペンタジエン、トリシクロペン タジエン、ノルボルナジエン等の脂肪族環状ポリエン化 合物系、ビニルシクロペンテン、ビニルシクロヘキセン 等の置換脂肪族環状オレフィン化合物系等が挙げられ

【0035】上記した(A)成分としては、耐熱性をよ り向上し得るという観点から、SiH基と反応性を有す る炭素-炭素二重結合を(A)成分1gあたり0.00 1m01以上含有するものであればよいが、さらに、1 gあたり0.005mol以上含有するものが好まし

く、0.008mol以上含有するものが特に好まし

【0036】(A)成分のSiH基と反応性を有する炭 素-炭素二重結合の数は、平均して1分子当たり少なく とも2個あればよいが、力学強度をより向上したい場合 には2を越えることが好ましく、3個以上であることが より好ましい。(A)成分のSiH基と反応性を有する 炭素 - 炭素二重結合の数が1分子内当たり1個以下の場 合は、(B)成分と反応してもグラフト構造となるのみ で架橋構造とならない。

【0037】(A)成分としては、他の成分との均一な 混合、および良好な作業性を得るためには100℃以下 の温度において流動性があるものが好ましく、線状でも 枝分かれ状でもよく、分子量は特に制約はないが、50 ~100,000の任意のものが好適に使用できる。分 子量が100,000以上では一般に原料が高粘度とな り作業性に劣るとともに、炭素-炭素二重結合とSiH 50 基との反応による架橋の効果が発現し難い。

【0038】また、(A)成分としては、着色特に黄変 の抑制の観点からフェノール性水酸基および/あるいは フェノール性水酸基の誘導体を有する化合物の含有量が 少ないものが好ましく、フェノール性水酸基および/あ るいはフェノール性水酸基の誘導体を有する化合物を含 まないものがより好ましい。本発明におけるフェノール 性水酸基とはベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン 環等に例示される芳香族炭化水素核に直接結合した水酸 基を示し、フェノール性水酸基の誘導体とは上述のフェ ノール性水酸基の水素原子をメチル基、エチル基等のア ルキル基、ビニル基、アリル基等のアルケニル基、アセ トキシ基等のアシル基等により置換された基を示す。

【0039】また複屈折率が低い、光弾性係数が低い等 のように光学特性が良好であるとともに耐候性が良好で あるという観点からは、芳香環の(A)成分中の成分重 量比が50重量%以下であるものが好ましく、40重量 %以下のものがより好ましく、30重量%以下のものが さらに好ましい。最も好ましいのは芳香族炭化水素環を 含まないものである。

【0040】得られる硬化物の着色性および光学特性か ら、(A)成分としてはビニルシクロヘキセン、ジシク ロベンタジエン、トリアリルイソシアヌレート、2.2 - ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロパンのジ アリルエーテル、1,2,4-トリビニルシクロヘキサ ンが好ましく、トリアリルイソシアヌレート、2,2-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロバンのジア リルエーテル、1,2,4-トリビニルシクロヘキサン が特に好ましい。

【0041】次に、(B) 成分であるSiH基を有する 化合物について説明する。

【0042】本発明に使用できるSiH基を有する化合 物については特に制限がなく、例えば国際公開WO96 /15194に記載される化合物で、1分子中に少なく とも2個のSiH基を有するもの等が使用できる。

【0043】 これらのうち、入手性の面からは、1分子 中に少なくとも2個のSiH基を有する鎖状、及び/又 は、環状ポリオルガノシロキサンが好ましく、(A)成 分との相溶性が良いという観点から、さらに、下記一般 式(III)

[0044]

【化10】

(III)

【0045】(式中、R2は炭素数1~6の有機基を表 し、nは3~10の数を表す。) で表される、1分子中 に少なくとも2個のSiH基を有する環状ポリオルガノ シロキサンが好ましい。なお、一般式(III)で表さ 50 シロキサンとジシクロベンタジエンの反応物、1,3,

れる化合物中の置換基R² は、C、H、Oから構成され るものであることが好ましく、炭化水素基であることが より好ましい。

【0046】また、前記(A)成分と良好な相溶性を有 するという観点からは、鎖状、及び/又は、環状ポリオ ルガノシロキサンと、炭素 – 炭素二重結合を有する有機 化合物から選ばれた1種以上の化合物(以降(E)成分 と称する)との反応物も好ましい。この場合、反応物の (A) 成分との相溶性をさらに高めるために、反応物か ら未反応のシロキサン類等を脱揮等により除去したもの を用いることもできる。

【0047】(E)成分はSiH基と反応性を有する炭 素-炭素二重結合を1分子中に少なくとも1個含有する 有機系骨格からなる有機化合物であって、前記(A)成 分と同じ説明のものも使用できる。(E)成分の有機化 合物は、(A)成分の有機化合物と同じであってもよ く、異なっていてもよい。また単独もしくは2種以上の ものを混合して用いることが可能である。(B)成分の (A)成分に対する相溶性を高くしたい場合には、

(E) 成分は(A) 成分と同一のものが好ましい。 【0048】(E)成分の有機化合物と反応させる鎖 状、及び/又は、環状ポリオルガノシロキサンとして は、工業的入手性および反応させる場合の反応性が良好 であるという観点からは、1,3,5,7-テトラメチ ルテトラシクロシロキサンが好ましい。

【0049】(B)成分としても(A)成分と同様に、 着色特に黄変の抑制の観点からフェノール性水酸基およ び/あるいはフェノール性水酸基の誘導体を有する化合 物の含有量が少ないものが好ましく、フェノール性水酸 30 基および/あるいはフェノール性水酸基の誘導体を有す る化合物を含まないものがより好ましい。本発明におけ るフェノール性水酸基とはベンゼン環、ナフタレン環、 アントラセン環等に例示される芳香族炭化水素核に直接 結合した水酸基を示し、フェノール性水酸基の誘導体と は上述のフェノール性水酸基の水素原子をメチル基、エ チル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基等のアルケ ニル基、アセトキシ基等のアシル基等により置換された

【0050】また複屈折率が低い、光弾性係数が低い等 40 のように光学特性が良好であるとともに耐候性が良好で あるという観点からは、芳香環の(B)成分中の成分重 量比が50重量%以下であるものが好ましく、40重量 %以下のものがより好ましく、30重量%以下のものが さらに好ましい。最も好ましいのは芳香族炭化水素環を 含まないものである。

【0051】光学特性が良好であるという観点からより 好ましい(B) 成分としては、1,3,5,7-テトラ メチルテトラシクロシロキサンとビニルシクロヘキセン の反応物、1、3、5、7-テトラメチルテトラシクロ

5、7ーテトラメチルテトラシクロシロキサンとトリアリルイソシアヌレートの反応物、1、3、5、7ーテトラメチルテトラシクロシロキサンと2、2ービス(4ーヒドロキシシクロへキシル)プロパンのジアリルエーテルの反応物、1、3、5、7ーテトラメチルテトラシクロシロキサンと1、2、4ートリビニルシクロへキサンとトリアリルイソシアヌレートの反応物、1、3、5、7ーテトラメチルテトラシクロシロキサンと2、2ービス(4ーヒドロキシシクロへキシル)プロパンのジアリルエーテルの反応物、1、3、5、7ーテトラメチルテトラシクロシロキサンと2、2ードリンの反応物等が挙げられる。

【0052】上記したような (A) 成分と (B) 成分の混合比率は、必要な強度を失わない限りは特に限定されないが、 (B) 成分中のS i H基の数 (Y) の (A) 成分中の炭素-炭素二重結合の数 (X) に対する比が、 $2.0 \ge Y/X \ge 0.9$ であることが好ましく、 $1.8 \ge Y/X \ge 1.0$ がより好ましい。2.0 < Y/X の場合は、十分な硬化性が得られず、充分な強度が得られない場合があり、Y/X < 0.9 の場合は炭素-炭素二重結合が過剰となり着色の原因となり得る。

【0053】次に(C)成分であるヒドロシリル化触媒 について説明する。ヒドロシリル化触媒としては、ヒド ロシリル化反応の触媒活性があれば特に限定されない が、例えば、白金の単体、アルミナ、シリカ、カーボン ブラック等の担体に固体白金を担持させたもの、塩化白 金酸、塩化白金酸とアルコール、アルデヒド、ケトン等 との錯体、白金-オレフィン錯体(例えば、Pt (CH 30) $_{2} = CH_{2}$) $_{2}$ (PPh₃) $_{2}$, Pt (CH₂ = C H₂)₂Cl₂)、白金-ビニルシロキサン錯体(例え ば、Pt (ViMe2 SiOSiMe2 Vi),、Pt [(MeViSiO) ₄] 』)、白金ーホスフィン錯体 (例えば、Pt (PPhs) 、Pt (PB us)。)、白金-ホスファイト錯体(例えば、Pt [P (OPh),], Pt [P (OBu),],) (式中、Meはメチル基、Buはブチル基、Viはビニ ル基、Phはフェニル基を表し、n、mは、整数を示 す。)、ジカルボニルジクロロ白金、カールシュテト (Karstedt) 触媒、また、アシュピー (Ash by)の米国特許第3159601号および31596 62号明細書中に記載された白金-炭化水素複合体、な らびにラモロー(Lamoreaux)の米国特許第3 220972号明細書中に記載された白金アルコラート 触媒が挙げられる。さらに、モディック(Modic) の米国特許第3516946号明細書中に記載された塩 化白金-オレフィン複合体も本発明において有用であ る。

【0054】また、白金化合物以外の触媒の例として

は、RhCl(PPh)。、RhCl。、RhAl2O。、RuCl。、IrCl。、FeCl。、AlCl。、PdCl2・2H2O、NiCl2、TiCl2、等が挙げられる。

【0055】とれらの中では、触媒活性の点から塩化白金酸、白金-オレフィン錯体、白金-ビニルシロキサン 錯体等が好ましい。また、これらの触媒は単独で使用してもよく、2種以上併用してもよい。

【0056】触媒の添加量は特に限定されないが、十分な硬化性を有し、かつ硬化性組成物のコストを比較的低く抑えるために、SiH基1モルに対して、 $10^{-6}\sim10^{-2}$ モルの範囲が好ましく、より好ましくは、 $10^{-6}\sim10^{-2}$ モルの範囲である。

【0057】また、上記触媒には助触媒を併用することが可能であり、例としてトリフェニルホスフィン等のリン系化合物、ジメチルマレエート等の1、2-ジェステル系化合物、2-ヒドロキシー2-メチルー1-ブチン等のアセチレンアルコール系化合物、単体の硫黄等の硫黄系化合物、トリエチルアミン等のアミン系化合物等が挙げられる。助触媒の添加量は特に限定されないが、触媒1モルに対して、 $10^{-2}\sim10^2$ モルの範囲が好ましく、より好ましくは $10^{-1}\sim10$ モルの範囲である。

【0058】さらに本発明の組成物の保存安定性を改良 する目的、あるいは製造過程でのヒドロシリル化反応の 反応性を調整する目的で、硬化遅延剤を使用することが できる。硬化遅延剤としては、脂肪族不飽和結合を含有 する化合物、有機リン化合物、有機イオウ化合物、窒素 含有化合物、スズ系化合物、有機過酸化物等が挙げら れ、これらを併用してもかまわない。脂肪族不飽和結合 を含有する化合物として、プロバルギルアルコール類、 エンーイン化合物類、マレイン酸エステル類等が例示さ れる。有機リン化合物としては、トリオルガノフォスフ ィン類、ジオルガノフォスフィン類、オルガノフォスフ ォン類、トリオルガノフォスファイト類等が例示され る。有機イオウ化合物としては、オルガノメルカブタン 類、ジオルガノスルフィド類、硫化水素、ベンゾチアゾ ール、ベンゾチアゾールジサルファイド等が例示され る。窒素含有化合物としては、アンモニア、1~3級ア 40 ルキルアミン類、アリールアミン類、尿素、ヒドラジン 等が例示される。スズ系化合物としては、ハロゲン化第 一スズ2水和物、カルボン酸第一スズ等が例示される。 有機過酸化物としては、ジーtーブチルベルオキシド、 ジクミルペルオキシド、ベンゾイルペルオキシド、過安 息香酸 t - ブチル等が例示される。

【0059】これらの硬化遅延剤のうち、遅延活性が良好で原料入手性がよいという観点からは、ベンゾチアゾール、チアゾール、ジメチルマレエート、3-ヒドロキシー3-メチルー1-ブチンが好ましい。

50 【0060】硬化遅延剤の添加量は、使用するヒドロシ

リル化触媒 1 m o 1 に対し、10 ^{- 1} ~10 ^s モルの範 囲が好ましく、より好ましくは 1 ~5 0 モルの範囲であ る。

【0061】本発明の組成物としては上記したように各種組み合わせのものが使用できるが、耐熱性が良好であるという観点から、組成物を硬化させて得られる硬化物のTgが50℃以上となるものが好ましく、100℃以上となるものがさらに好ましく、150℃以上となるものが特に好ましい。

【0062】本発明の組成物には必要に応じて無機フィラーを添加してもよい。無機フィラーを添加すると、組成物の流動性の防止、材料の高強度化に効果がある。無機フィラーとしては光学特性を低下させない、微粒子状なものが好ましく、アルミナ、水酸化アルミニウム、溶融シリカ、結晶性シリカ、超微粉無定型シリカや疎水性超微粉シリカ、タルク、硫酸バリウム等を挙げることができる。

【0063】フィラーを添加する方法としては、例えばアルコキシシラン、アシロキシシラン、ハロゲン化シラン等の加水分解性シランモノマーあるいはオリゴマーや、チタン、アルミニウム等の金属のアルコキシド、アシロキシド、ハロゲン化物等を、本発明の組成物に添加して、組成物中あるいは組成物の部分反応物中で反応させ、組成物中で無機フィラーを生成させる方法も挙げるととができる。

【0064】また更に、本発明の組成物の特性を改質す る目的で、種々の樹脂を添加することも可能である。樹 脂としては、ポリカーボネート樹脂、ポリエーテルスル ホン樹脂、ポリアリレート樹脂、エポキシ樹脂、シアナ ート樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド 樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ウレタン樹脂及びポ リエステル樹脂等が例示されるがこれに限定されるもの ではない。これらのうち、透明性が高く接着性等の実用 特性に優れるという観点から、透明エポキシ樹脂が好ま しい。透明エポキシ樹脂としては、例えばピスフェノー ルAジグリシジルエーテル、2、2'-ビス(4-グリ シジルオキシシクロヘキシル)プロパン、3、4-エポ キシシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシシクロヘ キサンカーボキシレート、ビニルシクロヘキセンジオキ サイド、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)-5,5-スピロー(3,4-エポキシシクロヘキサン) -1,3-ジオキサン、ビス(3,4-エポキシシクロ ヘキシル) アジペート、1,2-シクロプロパンジカル ボン酸ピスグリシジルエステル、トリグリシジルイソシ アヌレート等のエポキシ樹脂を、ヘキサヒドロ無水フタ ル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、トリアルキル テトラヒドロ無水フタル酸、水素化メチルナジック酸無 水物等の脂肪族酸無水物で硬化させるものが挙げられ

【0065】本発明の組成物をそのままフィルム等に成 50 -アクリロキシプロビルトリエトキシシラン、メタクリ

形することも可能であるが、該組成物を有機溶剤に溶解 してワニスとすることも可能である。使用できる溶剤は 特に限定されるものではなく、具体的に例示すれば、ベ ンゼン、トルエン、ヘキサン、ヘブタン等の炭化水素系 溶媒、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、ジェ チルエーテル等のエーテル系溶媒、アセトン、メチルエ チルケトン等のケトン系溶媒、クロロホルム、塩化メチ レン、1,2-ジクロロエタン等のハロゲン系溶媒を好 適に用いることができる。溶媒は2種類以上の混合溶媒 として用いることもできる。溶媒としては、トルエン、 テトラヒドロフラン、クロロホルムが好ましい。使用す る溶媒量は、用いる(A)成分1gに対し、0~10m Lの範囲で用いるのが好ましく、0.5~5mLの範囲 で用いるのがさらに好ましく、1~3mLの範囲で用い るのが特に好ましい。使用量が少ないと、低粘度化等の 溶媒を用いることの効果が得られにくく、また、使用量 が多いと、材料に溶剤が残留して熱クラック等の問題と なり易く、またコスト的にも不利になり工業的利用価値 が低下する。

(0066)本発明の組成物には、その他、老化防止剤、ラジカル禁止剤、紫外線吸収剤、接着性改良剤、難燃剤、界面活性剤、保存安定改良剤、オゾン劣化防止剤、光安定剤、増粘剤、可塑剤、カップリング剤、酸化防止剤、熱安定剤、導電性付与剤、帯電防止剤、放射線遮断剤、核剤、リン系過酸化物分解剤、滑剤、顔料、金属不活性化剤、物性調整剤等を本発明の目的および効果を損なわない範囲において添加することができる。

【0067】なお、カップリング剤としては例えばシランカップリング剤が挙げられる。シランカップリング剤としては、分子中に有機基と反応性のある官能基と加水分解性のケイ素基を各々少なくとも1個有する化合物であれば特に限定されない。有機基と反応性のある基としては、取扱い性の点からエポキシ基、メタクリル基、アクリル基、イソシアネート基、イソシアヌレート基、ビニル基、カルバメート基から選ばれる少なくとも1個の官能基が好ましく、硬化性及び接着性の点から、エポキシ基、メタクリル基、アクリル基が特に好ましい。加水分解性のケイ素基としては取扱い性の点からアルコキシシリル基が好ましく、反応性の点からメトキシシリル基が特に好ましい。

【0068】好ましいシランカップリング剤としては、3-グリシドキシプロビルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロビルトリエトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリエトキシシラン類:3-メタクリロキシプロビルトリエトキシシラン、3-アクリロキシプロビルトリエトキシシラン、3-アクリロキシプロビルトリエトキシシラン、3-アクリロキシプロビルトリエトキシ

ロキシメチルトリメトキシシラン、メタクリロキシメチルトリエトキシシラン、アクリロキシメチルトリメトキシシラン、アクリロキシメチルトリエトキシシラン等の メタクリル基あるいはアクリル基を有するアルコキシシラン類が例示できる。

【0069】さらに、本発明の組成物には種々の発光ダイオード特性改善のための添加剤を添加してもよい。添加剤としては例えば、発光素子からの光を吸収してより長波長の蛍光を出す、セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体等の蛍光体や、特定の波長を吸収するブルーイング剤等の着色剤、光を拡散させるための酸化チタン、酸化アルミニウム、シリカ、石英ガラス等の酸化ケイ素、タルク、炭酸カルシウム、メラミン樹脂、CTUグアナミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂等のような各種無機あるいは有機拡散材、ガラス、アルミノシリケート等の金属酸化物、窒化アルミニウム、窒化ボロン等の金属窒化物等の熱伝導性フィラー等を挙げることができる。

【0070】発光ダイオード特性改善のための添加剤は 均一に含有させても良いし、含有量に傾斜を付けて含有 20 させてもよい。この様なフィラー含有樹脂部は発光面前 面のモールド部材用の樹脂を型に流した後、引き続い て、フィラーを含有させた樹脂を流し、発光面後方のモールド部材として形成させることができる。また、モールド部材形成後、リード端子を表裏両面からテープを張り付けることによって覆い、この状態でリードフレーム 全体をフィラー含有樹脂を溜めたタンク内に発光ダイオードのモールド部材の下半分を浸漬した後、引き上げて 乾燥させフィラー含有樹脂部を形成させても良い。

【0071】本発明の硬化性組成物は、あらかじめ混合し、組成物中のSiH基と反応性を有する炭素 – 炭素二重結合とSiH基の一部または全部を反応させることによって硬化させることができる。

【0072】混合の方法としては、各種方法をとることができるが、(A)成分に(C)成分を混合したものと、(B)成分を混合する方法が好ましい。(A)成分と(B)成分との混合物に(C)成分を混合する方法だと反応の制御が困難である。(B)成分に(C)成分を混合したものに(A)成分を混合する方法をとる場合は、(C)成分の存在下では(B)成分が水分と反応性 40を有するため、貯蔵中等に変質することもある。

【0073】組成物を反応させて硬化させる場合において、(A)、(B)、(C)各成分それぞれの必要量を一度に混合して反応させてもよいが、一部を混合して反応させた後残量を混合してさらに反応させる方法や、混合した後反応条件の制御や置換基の反応性の差の利用により組成物中の官能基の一部のみを反応(Bステージ化)させてから成形等の処理を行いさらに硬化させる方法をとることもできる。これらの方法によれば成形時の粘度調整が容易となる。

【0074】反応させる方法としては、単に混合するだけで反応させることもできるし、加熱して反応させることもできる。反応が速く、一般に耐熱性の高い材料が得られやすいという観点から加熱して反応させる方法が好ましい。

【0075】反応温度としては種々設定できるが、例えば30~300℃の温度が適用でき、100~250℃がより好ましく、150~200℃がさらに好ましい。反応温度が低いと十分に反応させるための反応時間が長くなり、反応温度が高いと成形加工が困難となりやすい。反応は一定の温度で行ってもよいが、必要に応じて多段階あるいは連続的に温度を変化させてもよい。

【0076】反応時間も種々設定できるし、反応時の圧力も必要に応じ種々設定でき、常圧、高圧、あるいは減圧状態で反応させることもできる。

【0077】成形時に必要に応じ各種処理を施すこともできる。例えば、成形時に発生するボイドの抑制のために組成物あるいは一部反応させた組成物を遠心、減圧、加圧等により脱泡する処理等を適用することもできる。 【0078】本発明の発光ダイオードは上記したような硬化性組成物によって発光素子を被覆することによって

製造することができる。

【0079】この場合発光素子とは、特に限定なく従来公知の発光ダイオードに用いられる発光素子を用いることができる。このような発光素子としては、例えば、MOCVD法、HDVPE法、液相成長法といった各種方法によって、必要に応じてGaN、A1N等のバッファー層を設けた基板上に半導体材料を積層して作成したものが挙げられる。この場合の基板としては、各種材料を30 用いることができるが、例えばサファイア、スピネル、SiC、Si、ZnO、GaN単結晶等が挙げられる。これらのうち、結晶性の良好なGaNを容易に形成でき、工業的利用価値が高いという観点からは、サファイアを用いることが好ましい。

【0080】積層される半導体材料としては、GaAs、GaP、GaAlAs、GaAsP、AlGaInP、GaN、InN、AlN、InGaN、InGaAlN、SiC等が挙げられる。これらのうち、高輝度が得られるという観点からは、窒化物系化合物半導体(In、Ga、Al、N)が好ましい。このような材料には付活剤等を含んでいてもよい。

【0081】発光素子の構造としては、MIS接合、pn接合、PIN接合を有するホモ接合、ヘテロ接合やダブルヘテロ構造等が挙げられる。また、単一あるいは多重量子井戸構造とすることもできる。

【0082】発光素子はパッシベーション層を設けていてもよいし、設けなくてもよい。

【0083】発光素子には従来知られている方法によって電極を形成することができる。

0 【0084】発光素子の発光波長は紫外域から赤外域ま

21

で種々のものを用いることができるが、主発光ピーク波 長が550nm以下のものを用いた場合に特に本発明の 効果が顕著である。

【0085】用いる発光素子は一種類で単色発光させて も良いし、複数用いて単色或いは多色発光させても良い。

【0086】発光素子上の電極は種々の方法でリード端子等と電気接続できる。電気接続部材としては、発光素子の電極とのオーミック性機械的接続性等が良いものが好ましく、例えば、金、銀、銅、白金、アルミニウムや 10 それらの合金等を用いたボンディングワイヤーが挙げられる。また、銀、カーボン等の導電性フィラーを樹脂で充填した導電性接着剤等を用いることもできる。これらのうち、作業性が良好であるという観点からは、アルミニウム線或いは金線を用いることが好ましい。

【0087】本発明の発光ダイオードに用いられるリード端子としては、ボンディングワイヤー等の電気接続部材との密着性、電気伝導性等が良好なものが好ましく、リード端子の電気抵抗としては、300μΩ-cm以下が好ましく、より好ましくは3μΩ-cm以下である。これらのリード端子材料としては、例えば、鉄、銅、鉄入り銅、錫入り銅や、これらに銀、ニッケル等をメッキしたもの等が挙げられる。これらのリード端子は良好な光の広がりを得るために適宜光沢度を調整してもよい。

光の仏がりを得るために適宜光沢度を調整してもよい。【0088】本発明の発光ダイオードは上記したような硬化性組成物によって発光素子を被覆することによって製造することができるが、この場合被覆とは、上記発光素子を直接封止するものに限らず、間接的に被覆する場合も含む。具体的には、発光素子を本発明の硬化性組成物で直接従来用いられる種々の方法で封止してもよいし、従来用いられるエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、カリル樹脂、ユリア樹脂、イミド樹脂等の封止樹脂やガラスで発光素子を封止した後に、その上あるいは周囲を本発明の硬化性組成物で封止した後、従来用いられるエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、コリア樹脂、イミド樹脂等でモールディングしてもよい。以上のような方法によって屈折率や比重の差によりレンズ効果等の種々の効果をもたせることも可能である。

【0089】封止の方法としても各種方法を適用するこ 40 とができる。例えば、底部に発光素子を配置させたカップ、キャビディ、パッケージ凹部等に液状の硬化性組成物をディスペンサーその他の方法にて注入して加熱等により硬化させてもよいし、固体状あるいは高粘度液状の硬化性組成物を加熱する等して流動させ同様にパッケージ凹部等に注入してさらに加熱する等して硬化させてもよい。この場合のパッケージは種々の材料を用いて作成することができ、例えば、ボリカーボネート樹脂、ボリフェニレンスルフィド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、ABS樹脂等を挙げることができ 50

る。また、モールド型枠中に硬化性組成物をあらかじめ 注入し、そこに発光素子が固定されたリードフレーム等 を浸漬した後硬化させる方法も適用することができる し、発光索子を挿入した型枠中にディスペンサーによる 注入、トランスファー成形、射出成形等により硬化性組 成物による封止層を成形、硬化させてもよい。さらに、 単に液状または流動状態とした硬化性組成物を発光素子 上に滴下あるいはコーティングして硬化させてもよい。 あるいは、発光素子上に孔版印刷、スクリーン印刷、あ るいはマスクを介して塗布すること等により硬化性樹脂 を成形させて硬化させることもできる。その他、あらか じめ板状、あるいはレンズ形状等に部分硬化あるいは硬 化させた硬化性組成物を発光素子上に固定する方法によ ってもよい。さらには、発光素子をリード端子やパッケ ージに固定するダイボンド剤として用いることもできる し、発光素子上のパッシベーション膜として用いること もできる。また、パッケージ基板として用いることもで きる。

【0090】被覆部分の形状も特に限定されず種々の形20 状をとることができる。例えば、レンズ形状、板状、薄膜状、特開平6-244458記載の形状等が挙げられる。これらの形状は硬化性組成物を成形硬化させることによって形成してもよいし、硬化性組成物を硬化した後に後加工により形成してもよい。

【0091】本発明の発光ダイオードは、種々のタイプとすることができ、例えば、ランプタイプ、SMDタイプ、チップタイプ等いずれのタイプでもよい。SMDタイプ、チップタイプのバッケージ基板としては、種々のものが用いられ、例えば、エポキシ樹脂、BTレジン、セラミック等が挙げられる。

【0092】その他、本発明の発光ダイオードには従来 公知の種々の方式が適用できる。例えば、発光素子背面 に光を反射あるいは集光する層を設ける方式、封止樹脂 の黄変に対応して補色着色部を底部に形成させる方式、 主発光ピークより短波長の光を吸収する薄膜を発光素子 上に設ける方式、発光素子を軟質あるいは液状の封止材 で封止した後周囲を硬質材料でモールディングする方 式、発光素子からの光を吸収してより長波長の蛍光を出 す蛍光体を含む材料で発光素子を封止した後周囲をモー ルディングする方式、蛍光体を含む材料をあらかじめ成 形してから発光素子とともにモールドする方式、特開平 6-244458に記載のとおりモールディング材を特 殊形状として発光効率を高める方式、輝度むらを低減さ せるためにパッケージを2段状の凹部とする方式、発光 ダイオードを貫通孔に挿入して固定する方式、発光索子 表面に主発光波長より短い波長の光を吸収する薄膜を形 成する方式、発光素子をはんだバンプ等を用いたフリッ ブチップ接続等によってリード部材等と接続して基板方 向から光を取出す方式、等を挙げることができる。

0 【0093】本発明の発光ダイオードは従来公知の各種

の用途に用いることができる。具体的には、例えばバッ クライト、照明、センサー光源、車両用計器光源、信号 灯、表示灯、表示装置、面状発光体の光源、ディスプレ イ、装飾、各種ライト等を挙げることができる。 [0094]

【実施例】以下に、本発明の実施例および比較例を示す が、本発明は以下によって限定されるものではない。 (合成例1)200mLの二口フラスコに、磁気攪拌 子、冷却管をセットした。このフラスコにトルエン50 g、白金ビニルシロキサン錯体のキシレン溶液(白金と して3wt%含有) 11. 3μL、トリアリルイソシア ヌレート5.0g、1,3,5,7-テトラメチルシク ロテトラシロキサン37.04gを加えて、90℃のオ イルバス中で30分加温、攪拌した。さらに130℃の オイルバス中で2時間加熱還流させた。1-エチニル-1-シクロヘキサノール176mgを加えた。未反応の 1, 3, 5, 7-テトラメチルシクロテトラシロキサン およびトルエンを減圧留去した。「H-NMRによりこ のものは1,3,5,7-テトラメチルシクロテトラシ ロキサンのSiH基の一部がトリアリルイソシアヌレー 20 トと反応したもの(部分反応物Aと称す)であることが わかった。

(合成例2)1Lの四つ口フラスコに、攪拌装置、冷却 管、滴下漏斗をセットした。このフラスコにトルエン 1 90g、白金ビニルシロキサン錯体のキシレン溶液(白 金として3wt%含有) 48mg、1, 3, 5, 7-テ トラメチルシクロテトラシロキサン236、2gを入 れ、オイルバス中で70℃に加熱攪拌した。この溶液に 1, 2, 4-トリビニルシクロヘキサン20.0gのト ルエン10g溶液を1時間かけて滴下した。 得られた溶 液を70℃のオイルバス中で90分加温、攪拌した。1 -エチニル-1-シクロヘキサノール9.2mgを加え た。未反応の1、3、5、7-テトラメチルシクロテト ラシロキサンおよびトルエンを減圧留去した。! H-N MRによりこのものは1, 3, 5, 7ーテトラメチルシ クロテトラシロキサンのSiH基の一部が1,2,4-* * トリビニルシクロヘキサンと反応したもの(部分反応物 Bと称す) であることがわかった。

(作成例1)トリアリルイソシアヌレート2.5gと合 成例1で合成した部分反応物A3.0g、とをカップ中 で混合し、約1 torrの減圧下で30分脱泡した。合 成例1で示したように部分反応物Aは本発明の(C)成 分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。 このものを、2枚のガラス板に3mm厚みのシリコーン ゴムシートをスペーサーとしてはさみこんで作成したセ ルに流し、80℃/60分、100℃/60分、120 ℃/60分加熱を行い目視で均一かつ無色透明の硬化物 を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しない ものであった。

(作成例2)1,2,4-トリビニルシクロヘキサン 1.00gと合成例2で合成した部分反応物B1.87 g、とをカップ中で混合した。合成例2で示したように 部分反応物Bは本発明の(C)成分としての白金ビニル シロキサン錯体を含有している。このものを、2枚のガ ラス板に3mm厚みのシリコーンゴムシートをスペーサ ーとしてはさみこんで作成したセルに流し、100℃/ 60分加熱した。得られたゴム状の部分硬化物をセルか らはずしてあらためて2枚のガラス板にはさみこみ、1 20℃/180分、150℃/60分加熱を行い目視で 均一かつ無色透明の硬化物を得た。得られた硬化物は硬 質で表面タックを有しないものであった。

(測定例1) 従来、発光ダイオードの封止に用いられて いる透明エポキシ樹脂の硬化物とともに、吸水率および 低波長領域での光線透過性を評価した。

【0095】吸水率:30mm×5mm×3mmのサイ 30 ズの試験片を用いた以外はJISK6911に準拠した 方法により吸水率を求めた。

【0096】光線透過性:日立製作所製のU-3300 形ダブルモノクロ分光光度計を用いて3mm厚のサンプ ルの各波長における光線透過率を測定した。

[0097]

【表1】

	吸水	率(%	光彩	迭	過率	$\subseteq ($	%)							
	<u>. </u>		300	UII	350	Diff	400	nm	450	Diff	500	na	550	nm
作成例1	0	. 2		4	5	1	8	4	8	6	9	0	9	0
作成例 2	0	. 0	3	3	8	6	9	1	9	2	9	2	9	2
比較例(透明エポキシ樹脂)	0	. 6		0	\Box 1	1	8	5	8	8	9	0	9	ō

【0098】表1から明らかなように、本発明の発光ダ イオードに用いる硬化性組成物は吸水率が低く、特に低 波長領域での光線透過性が高く、発光ダイオードの発光 素子を被覆材として優れた特性を有している。

(測定例2)作成例1および2で作成した硬化物をスガ 試験機製のSX120型キセノンウェザーメーター (ブ ラックパネル温度63℃、照射2時間中降雨18分)に て70時間照射して硬化物が着色するかどうかを調べ た。作成例1および作成例2で作成した硬化物とも着色

オードに用いる硬化性組成物は優れた耐光性を有してい る.

(実施例1)トリアリルイソシアヌレート2.5gと合 成例1で合成した部分反応物A3.0g、とをカップ中 で混合し、約1torrの減圧下で30分脱泡した。合 成例1で示したように部分反応物Aは本発明の(C)成 分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。 このものを、2枚のガラス板に0.5mm厚みのシリコ ーンゴムシートをスペーサーとしてはさみこんで作成し がみられず無色透明の状態を保った。本発明の発光ダイ 50 たセルに流し、80℃/60分、100℃/60分、1

(14)

20℃/60分加熱を行い目視で均一かつ無色透明のシ ート状硬化物を得た。

【0099】上記のようにして作成したシート状硬化物 を適当な形状に切断し、キャンタイプ用の金属キャップ に設けた光透過用窓の部分に固定する。一方で、MOC VD (有機金属気相成長) 法によりサファイア基板上に 形成した、SiとZnがドープされたInGaN活性層 をn型とp型のAlGaNクラッド層で挟んだダブルへ テロ構造の発光素子を用意する。続いて、との発光素子 をキャンタイプ用の金属のステムに載置した後、p電 極、n電極をそれぞれのリードにAu線でワイヤーボン ディングする。これを上記のキャンタイプ用の金属キャ ップで気密封止する。この様にしてキャンタイプの発光 ダイオードを作成することができる。

(実施例2)トリアリルイソシアヌレート2.5gと合 成例1で合成した部分反応物A3.0g、とをカップ中 で混合し、約1torrの減圧下で30分脱泡し、硬化 性組成物とした。合成例1で示したように部分反応物A は本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯 体を含有している。

【0100】洗浄したサファイア基板上にMOCVD (有機金属気相成長) 法により、アンドープの窒化物半 導体であるn型GaN層、Siドープのn型電極が形成 されn型コンタクト層となるGaN層、アンドープの窒 化物半導体であるn型GaN層、次に発光層を構成する バリア層となるGaN層、井戸層を構成するInGaN 層、バリア層となるGaN層(量子井戸構造)、発光層 上にMgがドープされたp型クラッド層としてAIGa N層、Mgがドープされたp型コンタクト層であるGa N層を順次積層させる。エッチングによりサファイア基 30 板上の窒化物半導体に同一面側で、pn各コンタクト層 表面を露出させる。各コンタクト層上に、スパッタリン グ法を用いてAIを蒸着し、正負各電極をそれぞれ形成 させる。出来上がった半導体ウエハーをスクライブライ ンを引いた後、外力により分割させ発光素子を形成させ、

【0101】表面に銀でメッキされた鉄入り銅から構成 されるマウントリードのカップ底面上に、ダイボンド樹 脂としてエポキシ樹脂組成物を利用して上記発光素子を ダイボンドする。これを170℃で75分加熱しエポキ シ樹脂組成物を硬化させ発光素子を固定する。次に、発 光素子の正負各電極と、マウントリード及びインナーリ ードとをAu線によりワイヤーボンディングさせ電気的 導通を取る。

【0102】上記硬化性組成物を砲弾型の型枠であるキ ャスティングケース内に注入させる。上記の発光素子が カップ内に配置されたマウントリード及びインナーリー ドの一部をキャスティングケース内に挿入し100℃1 時間の初期硬化を行う。キャスティングケースから発光 ダイオードを抜き出し、窒素雰囲気下において120℃ 50 行い、負電極が形成されるn型コンタクト層の表面を露

1時間で硬化を行う。これにより砲弾型等のランプタイ プの発光ダイオードを作成することができる。

(実施例3) 実施例2 に記載の方法で硬化性組成物およ び発光素子を作成する。

【0103】エッチングにより一対の銅箔パターンをガ ラスエポキシ樹脂上に形成させることによって、リード 電極を持った基板を形成する。発光素子をエポキシ樹脂 を用いてガラスエボキシ樹脂上にダイボンドする。発光 素子の各電極と、各リード電極とをそれぞれAu線でワ イヤボンディングし電気的導通を取る。基板上にマスク 兼側壁として貫通孔があいたガラスエポキシ樹脂をエポ キシ樹脂により固定配置させる。この状態で真空装置内 に配置させると共に発光素子が配置されたガラスエポキ シ樹脂基板上に硬化性組成物をディスペンスし、貫通孔 を利用したキャビティ内に硬化性組成物を充填する。と の状態で、100℃1時間、さらに150℃1時間硬化 させる。各発光ダイオードチップごとに分割させること でチップタイプ発光ダイオードを作成することができ

(実施例4)実施例2に記載の方法で硬化性組成物およ 20 び発光素子を作成する。

【0104】インサート成形によりPPS樹脂を用いて チップタイプ発光ダイオードのパッケージを形成させ る。パッケージ内は、発光素子が配される開口部を備 え、銀メッキした銅板を外部電極として配置させる。パ ッケージ内部で発光索子をエポキシ樹脂を用いてダイボ ンドして固定する。 導電性ワイヤーであるAu線を発光 素子の各電極とバッケージに設けられた各外部電極とに それぞれワイヤーボンディングし電気的に接続させる。 パッケージ開口部内にモールド部材として硬化性組成物 を充填する。この状態で、100℃1時間、さらに15 0℃1時間硬化させる。この様にして、チップタイプ発 光ダイオードを作成することができる。

(実施例5)実施例2に記載の方法で硬化性組成物およ び発光素子を作成する。

【0105】硬化性組成物を90℃30分加熱してBス テージ化する。

【0106】エッチングにより一対の銅箔パターンをガ ラスエポキシ樹脂上に形成させることによって、リード 電極を持った基板を形成する。発光素子をエポキシ樹脂 を用いてガラスエボキシ樹脂上にダイボンドする。発光 素子の各電極と、各リード電極とをそれぞれAu線でワ イヤボンディングし電気的導通を取る。上記Bステージ 化した硬化性組成物を用いてトランスファー成形により 発光素子およびリード電極の一部を封止する。SMDタ イブの発光ダイオードを作成することができる。

【0107】(実施例6)実施例2と同様に順次積層さ れた窒化物半導体において、RIE(反応性イオンエッ チング) 装置で p 型窒化物半導体層側からエッチングを

出させる。次に、最上層にあるp型コンタクト層上のほ ぼ全面にリフトオフ法によりNi/Auを膜厚60/2 00人にて積層し、オーミック接触が良好で且つ優れた 透過性を有する第一の正電極を形成する。また、前記透 光性第一の正電極上の一部にAuを膜厚1μm積層し、 正極側ボンディング部となる第二の正電極を形成する。 【0108】一方、エッチングにより露出されたn型コ ンタクト層の表面にそれぞれターゲットを変えてスパッ タリングによりW/A1/W/Auを膜厚200A/2 000A/2000A/3000Aとなるよう積層し、 不要なレジスト膜を除去させ負電極を形成し、LED素 子とする。これにより、アニーリングを行わなくとも良 好なオーミック接触を有する負電極が形成される。ま た、負電極はボンディング部となるが、上記構成により 強い機械的強度を有するため、安定して駆動することが 可能なLED素子が得られる。

【0109】次に、バターニングにより、各電極のボンディング部のみを露出させ素子表面全体に接してSiO2からなる絶縁性無機化合物層を連続的に形成し、LED素子とする。前記絶縁性無機化合物層は少なくとも短20絡を防止できるように形成されていればよく、前記正電極と前記負電極の間の半導体層上面に設けられていればよい。このように絶縁性無機化合物層を設けることは、小型化された発光素子を信頼性高く実装するにあたり非常に重要である。絶縁性無機化合物層の材料は、少なくとも絶縁性であれば良く、例えばSiO2、TiO2、Al2Os、SisN。等からなる単層又は複数層を用いることができる。

【0110】また、本実施例では、前記絶縁性無機化合物層を発光素子の端面まで連続して設けている。これにより、基板の削られた端面及び露出面を高温高湿から保護することができ、厳しい環境条件下での長期間使用に際しても高い信頼性を維持することが可能な発光素子が得られる。また、サファイア基板や窒化ガリウムと直接接して設けられる絶縁性無機化合物層は、それぞれ接する部材と近い熱膨張係数を有することが好ましく、これにより更に信頼性を高めることができる。ちなみに、各材料の熱膨張係数は、サファイア基板が7.5~8.5×10⁻⁶/k、窒化ガリウムが3.2~5.6×10⁻⁶/k、二酸化珪素が0.3~0.5×10⁻⁶/k、窒化シリコンが2.5~3.0×10⁻⁶/kである。

【0111】本実施例で使用する発光素子は、発光層で発光された光の多くは上下の層との境界面にて全反射され、発光端部から光密度高く発光する傾向にある。このような発光素子を直接樹脂にて被覆すると、これらに発光素子からの光や熱が集中するため、隣接する樹脂部が局所的に著しく劣化される。これが起因となり、発光ダイオードに色調変化や信頼性低下が生じると考えられる。そこで本実施例では、絶縁性無機化合物層を表面に 50

有する発光素子を、前記絶縁性無機化合物層と比較的密着性が高い傾向にあり且つ耐光性及び耐熱性に優れた本発明の硬化性組成物にて直接被覆することにより、前記発光領域端部から発光される光を効率よく外部へ取り出し、界面における劣化を抑制し、信頼性の高い発光装置を提供する。

【0112】また、前記発光端部とは、発光層及びn型コンタクト層端部を示す。そこで、これらの端部に設けられる絶縁性無機化合物層は、n型コンタクト層としてよく用いられるGaNよりも屈折率が小さい無機物にて構成することが好ましい。これにより、硬化性樹脂の劣化を抑制することができる。更に、前記絶縁性無機化合物を、例えば、発光素子の発光端部に直接接する第一の層として SiO_2 を、該第一の層に接して該第一の層よりも屈折率の大きい第二の層として TiO_2 を積層した2層構造や、 SiO_2 /Al/ SiO_2 のように絶縁膜と金属の積層によって形成した3層構造とすることにより、反射性を持たせることもできる。複数層の場合、膜厚は5000人以上5 μ m以下が好ましく、 $l\mu$ m以上3 μ m以下がより好ましい。

【0113】また、無機化合物層を表面に有する発光素子を直接本発明の硬化性組成物にて被覆する場合、光屈折や熱膨張を考慮し、前記無機化合物層は珪素を含有するものが好ましい。珪素を含有する無機化合物層とは、前記無機化合物中に少なくとも珪素が含有されていれば特に限定されず、具体的には、SiO2、SiN、SiON、及びSiH4等からなる無機化合物層を設けての無機化合物層を本発明の硬化性組成物にて直接被覆すると、他の無機化合物層を設けた場合と比較して信頼性が向上し、高温高湿等の環境条件下においても高い信頼性及び光学特性を維持することができる傾向にある。この理由は定かでないが、珪素を含有する無機化合物層が本発明の硬化性組成物と親和性が良く密着性の高い界面を形成し、水分や外気の侵入が抑制されているためだと考えられる。

【0114】本発明では、上記無機化合物層に無機蛍光物質や有機蛍光物質等、種々の蛍光物質を含有させることが出来る。このような蛍光物質の一例として、無機蛍光体である希土類元素を含有する蛍光体がある。希土類元素含有蛍光体として、具体的には、Y、Lu、Sc、La、Gd及びSmの群から選択される少なくとも1つの元素と、Al、Ga及びInの群から選択される少なくとも1つの元素とを有するざくろ石型蛍光体が挙げられる。特に、セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光体が好ましく、所望に応じてCeに加えてb、Cu、Ag、Au、Fe、Cr、Nd、Dy、Ni、Ti、Eu及びPr等を含有させることも可能である。

【0115】上記のように形成されたLED素子を有す

るウエハをスクライブ可能な基板厚まで研磨工程によって削り、基板面が粘着シートに接触するように粘着シート上に載置し、スクライブ工程によってチップ状に分割する。分割されたLEDチップを実施例1と同様のパッケーシ内部に同様の方法にて固定し、Au線によりワイヤーボンディングさせ電気的に接続させ、本発明の硬化性組成物(実施例2と同様にして作成した硬化性組成物)にて被覆しチップタイプ発光ダイオートを作製する。

【0116】本発明の硬化性組成物は、優れた耐熱性且 10 つ強靭性を有している。本発明は、このような樹脂にて発光素子及びワイヤが被覆されることにより、実装時や点灯時の熱応力による樹脂及び発光素子におけるクラック発生やワイヤ断線を防止することができる。また、発光素子は点灯時に発熱を伴い、前記発光素子近傍は高温状態となる。本発明では、発光素子を直接被覆する樹脂として耐熱性に優れた本発明の硬化性組成物を用いるため、樹脂が劣化されることなく長時間の使用に際しても高い信頼性を維持することができる。また本発明の発光ダイオードは、Pbを有していない、高融点値を有する 20 導電部材にて実装しても、色度変動や信頼性低下を生じないため、環境に優しい表示装置を実現することができる。

【0117】また、本発明の硬化性組成物は、熱応力に おける柔軟性を有する硬化物である。従来、熱応力に柔 軟性を有する樹脂として、ゴム状弾性樹脂、ゲル樹脂等 が知られているが、これらの樹脂は架橋密度が低い又は 架橋構造を有さないので、機械的強度が弱い、またタッ ク性を有する等の問題点を有しており、最表面部となる 発光面として形成するには不向きであった。これに対し 本発明の硬化性組成物は、異物を吸着したり実装用器具 にて損傷を受ける恐れがない。このように本発明は、本 発明の硬化性組成物を用いることにより、発光素子及び ワイヤ部分の被覆部材と発光装置の表面部となる発光面 の部材を一体成形することができ、量産性及び作業性に 優れた発光ダイオードを得ることができる。また、太陽 光に対しても優れた耐光性を有するため、屋外用表示基 板に実装されても発光面は変色されず良好な信頼性を維 持することができる。

【0118】また、本発明の硬化性組成物に、前記発光素子の光の一部を吸収し他の波長の光を発光することが可能で且つ表面に前記硬化性樹脂と共通な無機元素を含有する物質をコーティングされた無機蛍光物質を添加すると、これらの界面は化学結合等により良好な密着性を有する傾向にある。また、前記蛍光物質は上記構成とすることにより前記硬化性樹脂中にて良好に分散した状態で固着される。これにより、前記無機蛍光物質の光吸収率及び光取り出し効率が向上され高輝度で均一に発光することが可能な色変換型発光ダイオードが得られる。

【0119】(実施例7)実施例3と同様の方法にて、

バッケージ内に発光素子を載置しワイヤにて電気的接続を取る。 ここでバッケージの開口部を除く表面にレジスト膜を形成する。 このようにLEDチップが載置されたバッケージを純水が入った容器内に配置させる。

【0120】他方、粒子状蛍光体は、Y、Gd、Ceの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で共沈させる。これを焼成して得られる共沈酸化物と、酸化アルミニウムとを混合して混合原料を得る。これにフラックスとしてフッ化アンモニウムを混合して坩堝に詰め、空気中1400°Cの温度で3時間焼成して焼成品を得る。焼成品を水中でボールミルして、洗浄、分離、乾燥、最後に篩を通して(YoasGdo2)sAlsO12:Ce蛍光体を形成する。こうして得られた蛍光物質をSiO2ゾル中に分散させてなる混合溶液を形成する。

【0121】次に、酢酸でpHを5.0に調整した後、直ちにパッケージが配置された容器中に前記混合溶液を一挙に注入する。静置後(YoaGdo2)。Al。O12:Ce蛍光体はパッケージの開口部及び発光素子上に沈降する。容器内の廃液を除去しLEDチップ上に粒子状蛍光体が堆積したパッケージを120℃で乾燥させる。

【0122】次に、容器から発光ダイオードを取り出して発光ダイオードの非発光部に付着した粒子状蛍光体をレジストマスクでと除去する。こうして得られた発光ダイオードは、LEDチップ上とパッケーシ底面との膜厚が共に約40μmと略等しい無機化合物層を有する。さらに、LEDチップや粒子状蛍光体を外部応力、太陽光、水分及び塵埃などから保護する目的で、無機化合物層が形成されたパッケージ開口部内にモールド部材として透光性である本発明の硬化性組成物(実施例2と同様にして作成した硬化性組成物)を充填し、150℃にて5時間硬化させる。

【0123】こうして得られた発光ダイオードは、耐久性に優れた部材にて構成されているため、厳しい環境下での使用や長時間の使用に際しても色ズレや色むらが生じることなく、優れた信頼性を有している。

【0124】(実施例8)ダイボンド樹脂として本発明の硬化性組成物(実施例2と同様にして作成した硬化性組成物)を利用する以外は、実施例2と同様にして発光ダイオードを形成する。このように構成することにより、発光素子の周囲の部材を全て耐熱性及び耐光性に優れた硬化性樹脂とすることができ、更に信頼性の高い発光ダイオードが得られる。

[0125]

【発明の効果】本発明の発光ダイオードに用いる硬化性組成物は吸水率が低く、特に低波長領域での光線透過性が高く、かつ、硬質であり表面タック性を有さず、発光ダイオードの発光素子の被覆材として優れた特性を有しているため、本発明の発光ダイオードは高い耐久性を有

し、かつ、実装する際に発光面に異物が付着したり実装 *い。 用器具により発光面が損傷を受けるという問題が生じな*

フロントページの続き

(72)発明者 大内 克哉

大阪府摂津市鳥飼西5丁目5-35-505

(72)発明者 津村 学

大阪府摂津市鳥飼西5丁目2-23浩然寮A

101

(72)発明者 坂本 晴美

大阪府摂津市鳥飼和道1丁目8-28サニー

コート401号室

(72)発明者 蔵本 雅史

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

(72)発明者 三木 倫英

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

Fターム(参考) 5F041 AA44 DA43 DA46